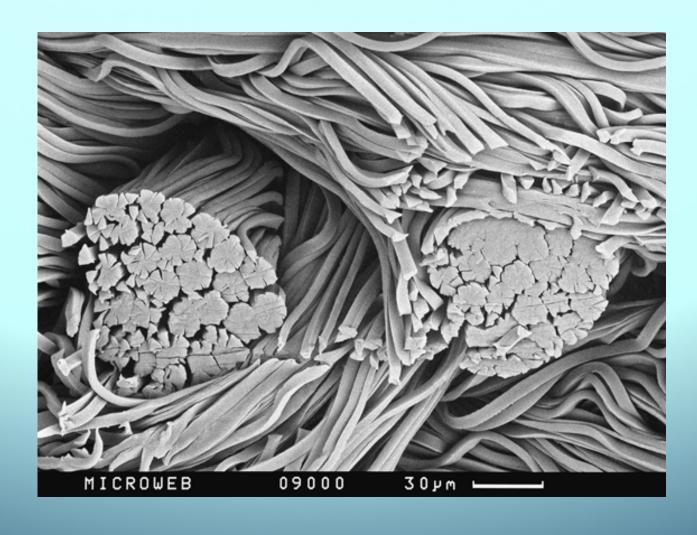




Das wischende Entfernen

nanoskaliger Verunreinigungen



I – Einführung

Tücherstruktur - Handhabung - Größenverhältnisse

II - Partikel

Instrumentarium, Vier Reinigungsbeispiele, Visualisierung mit AFM-Mikroskop Oligomere aus Polyestermatrix

III – Filme

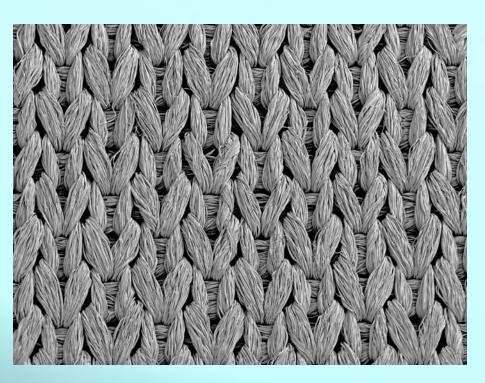
Massezunahme durch Wischvorgang, Schichtabtrag durch trockenes Wischen, Ellipsometer, chemische Rückstände im Tuch, Indikatorplatte

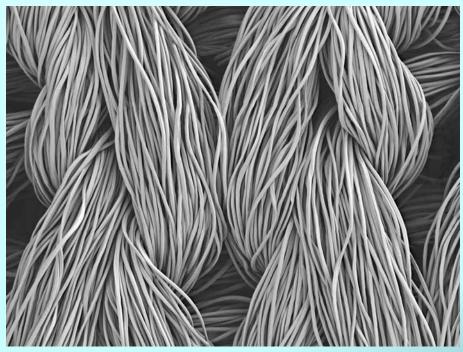
IV - Partikel + Filme

Kristallpartikel - mögliche Filmbildner, Filmeinbettung von 13 nm-Partikeln, Kristallisation nach Feuchtreinigung, Kristallisation nach Temperierung

IV – Untersuchungsergebnisse

Maschengebilde Reinraumtuch





REM-Fotos Yuko Labuda

30-fach 160-fach

Reinraum-Tücher diverse Arten handgerechter Formung



Knautschball-Formung



Tampon 2-Formung

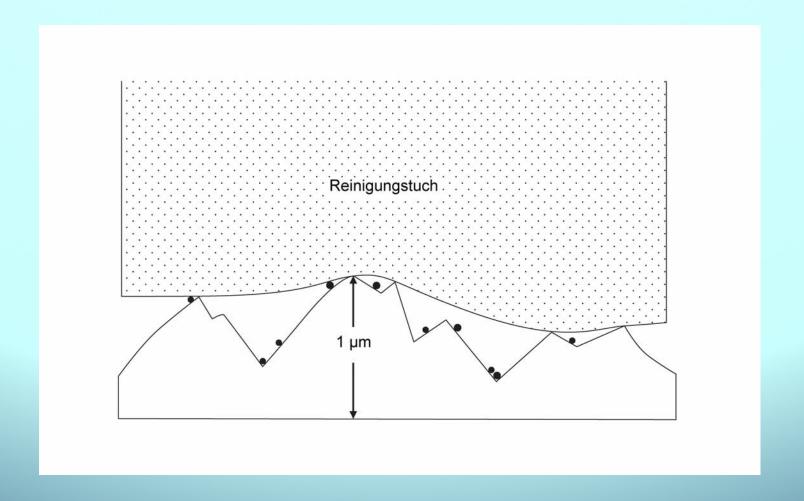


Tampon 1-Formung



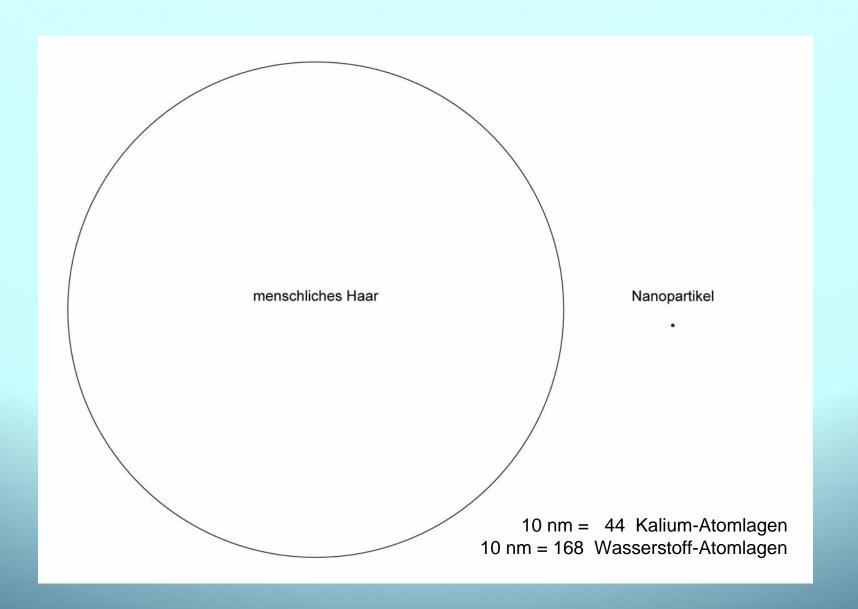
Lagen-Formung

Oberflächentopografie



1 µm Topografie im Vergleich zu Nanopartikeln von 50 nm ø

menschliches Haar neben Nanopartikel



I – Einführung

Tücherstruktur - Handhabung - Größenverhältnisse

II - Partikel

Instrumentarium, Vier Reinigungsbeispiele, Visualisierung mit AFM-Mikroskop Oligomere aus Polyestermatrix

III – Filme

Massezunahme durch Wischvorgang, Schichtabtrag durch trockenes Wischen, Ellipsometer, chemische Rückstände im Tuch, Indikatorplatte

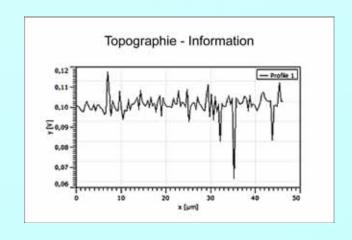
IV - Partikel + Filme

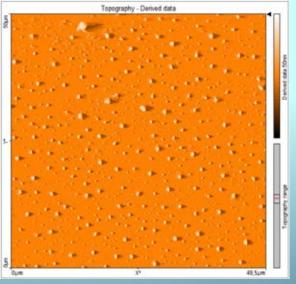
Kristallpartikel - mögliche Filmbildner, Filmeinbettung von 13 nm-Partikeln, Kristallisation nach Feuchtreinigung, Kristallisation nach Temperierung

IV – Untersuchungsergebnisse

NanoSurf AFM - Atomkraft Mikroskop

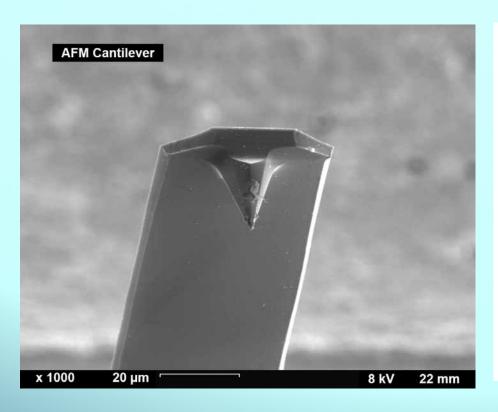


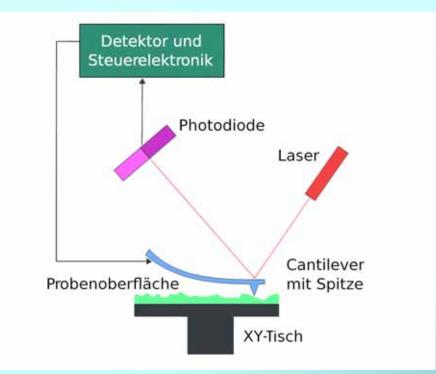




AFM – Atomkraft - Mikroskop

Cantilever-Spitze und Funktion





Cantilever-Spitze

Funktion des AFM

Flüssigkeits-Partikelzähler Vasco II Erfassungsbereich 0,3...6000 Nanometer

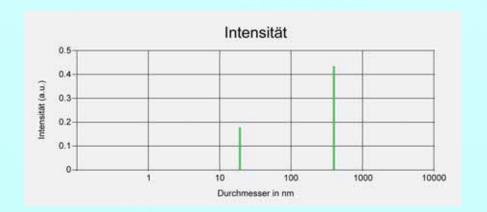
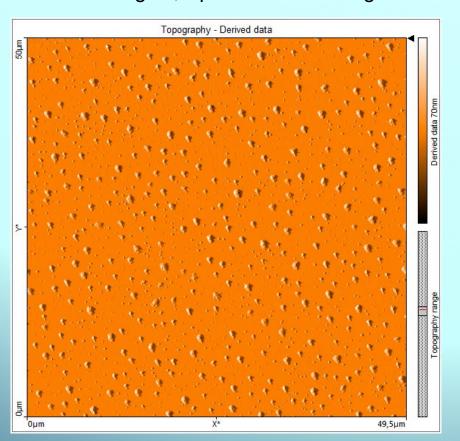


Diagramm: 13 nm Gold-Sphären in 0,5 ml DI-Wasser -Prüfung der für diese Messung verwendeten Goldpartikel auf Einhaltung der Angaben.

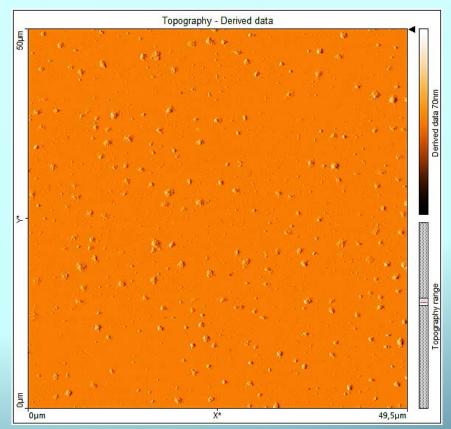
trockenes Wischen 1

AFM: Reinraumtuch 357 Maschen / cm²

Silikatglas, Spincoater - Auftrag



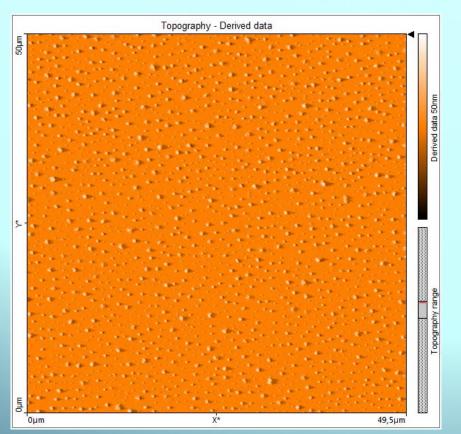
Nach trockenem Wischvorgang



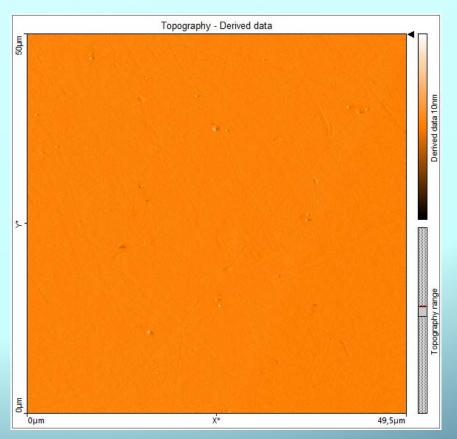
trockenes Wischen 2

AFM: Reinraumtuch 1056 Maschen / cm²

Silikatglas, Spincoater-Auftrag



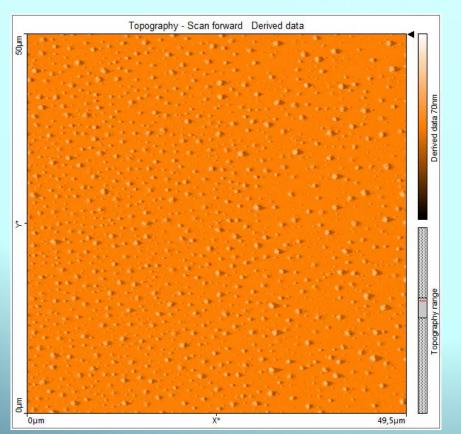
nach trockenem Wischvorgang



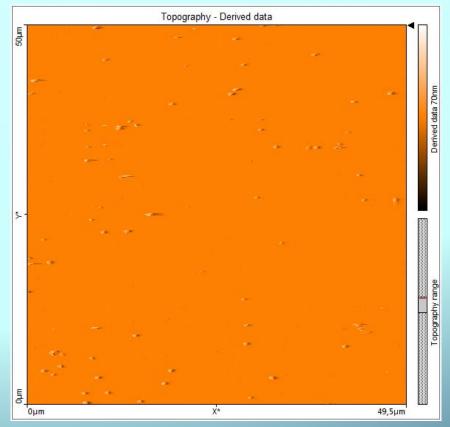
feuchtes Wischen 1

AFM: Reinraumtuch 357 Maschen / cm²

Silikatglas, Spincoater-Auftrag



nach feuchtem Wischvorgang



Gold-Sphären 50 nm

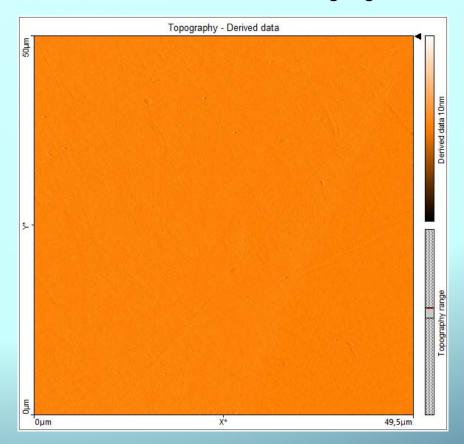
feuchtes Wischen 2

AFM: Reinraumtuch 1056 Maschen / cm²

Silikatglas-Oberfläche mit Partikeln

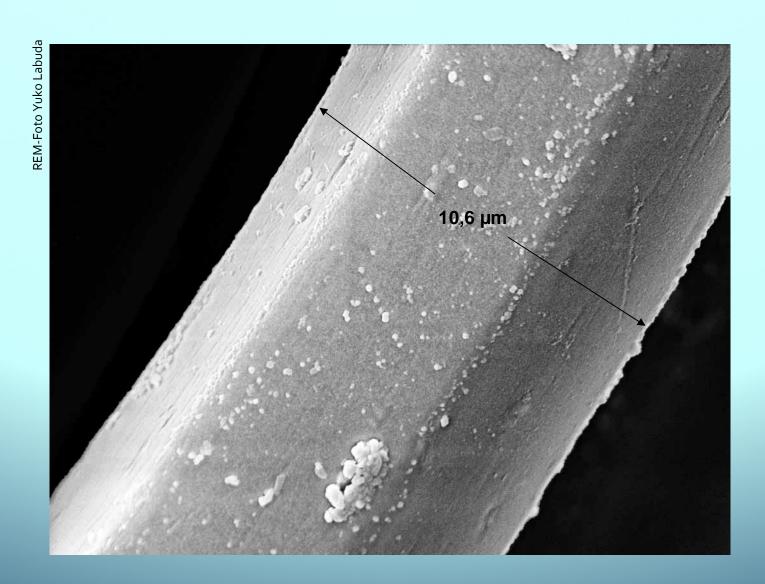
Topography - Scan forward Derived data

Nach feuchtem Wischvorgang



Gold-Sphären 50 nm

Oligomere auf Polyestermatrix Einzelfilament aus Garnstrang



I – Einführung

Tücherstruktur - Handhabung - Größenverhältnisse

II - Partikel

Instrumentarium, Vier Reinigungsbeispiele, Visualisierung mit AFM-Mikroskop Oligomere aus Polyestermatrix

III – Filme

chemische Rückstände auf Indikatorplatte, Massezunahme durch Wischvorgang, Schichtabtrag durch trockenes Wischen, Verunreinigungsrest nach Wischen

IV - Partikel + Filme

Kristallpartikel - mögliche Filmbildner, Filmeinbettung von 13 nm-Partikeln, Kristallisation nach Feuchtreinigung, Kristallisation nach Temperierung

IV – Untersuchungsergebnisse

Chemikalien-Rückstand auf Indikatorplatte Oligomere, Tenside, Spinn- und Stricköl

nach Aceton-Tränkung

nach 2-Propanol-Tränkung



Versuch: Oligomer-Darstellung

Versuch: Tensid-Darstellung

Piezoelektrische Waage - Stanford Wägebereich 0,5 - 1000 ng



Übertragung von Strick- und Spinnölresten aus einem Reinraumtuch auf die Quarzwaage

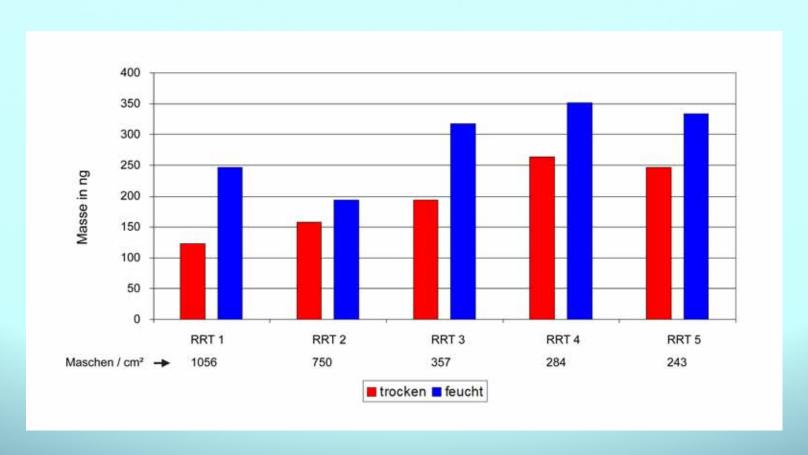
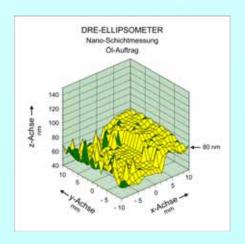
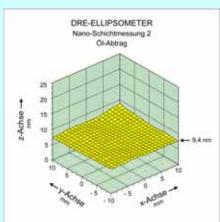


Diagramm: Gewichtszunahme eines Quarz-Kristalls nach trockenem / feuchtem Wischvorgang, Auswahl: 5 Reinraumtücher, RRT 1 - RRT 5 (Klammerwert = Maschen / cm²)

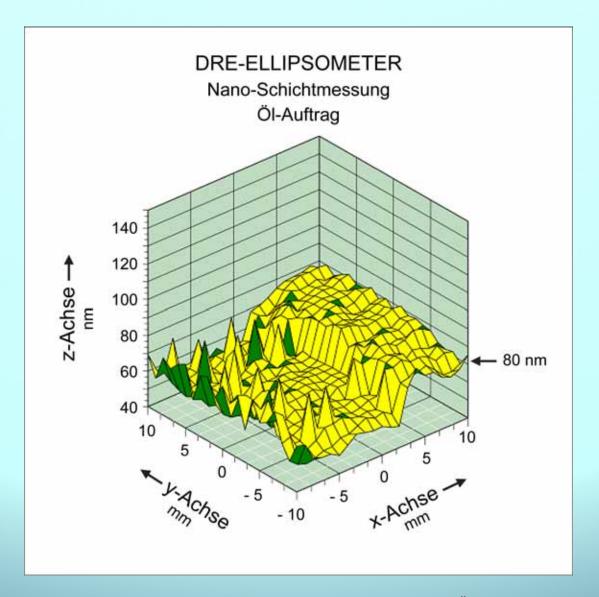
Mapping - Ellipsometer Verunreinigungsschicht vor und nach Wischvorgang



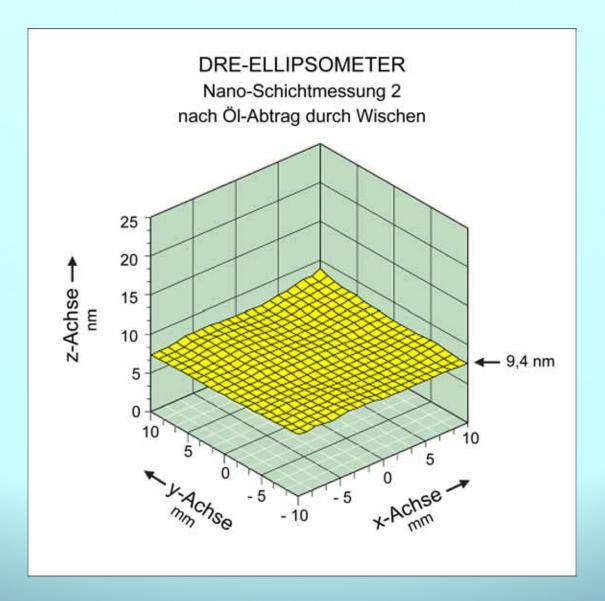




Dr. Riss – Ellipsometer

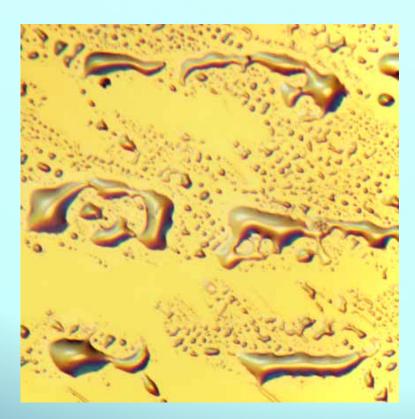


Substrat: beschichtetes Silikatglas - Walz-Auftrag einer Öl-Schicht



Substrat: beschichtetes Silikatglas - Reinigung trockenes Reinraum-Tuch

wischendes Entfernen eines Fingerabdrucks vor und nach Abwischen



Fingerabdruck im Differential-Interferenz-Kontrast (Ausschnitt)



Im DIC-Kontrast noch Rückstände im Spurenbereich sichtbar

I – Einführung

Tücherstruktur - Handhabung - Größenverhältnisse

II - Partikel

Instrumentarium, Vier Reinigungsbeispiele, Visualisierung mit AFM-Mikroskop Oligomere aus Polyestermatrix

III – Filme

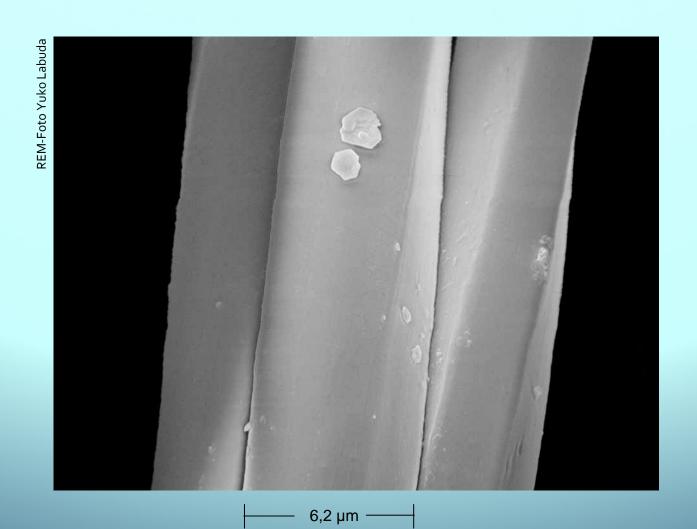
chemische Rückstände auf Indikatorplatte, Massezunahme durch Wischvorgang, Schichtabtrag durch trockenes Wischen, Verunreinigungsrest nach Wischen

IV - Partikel + Filme

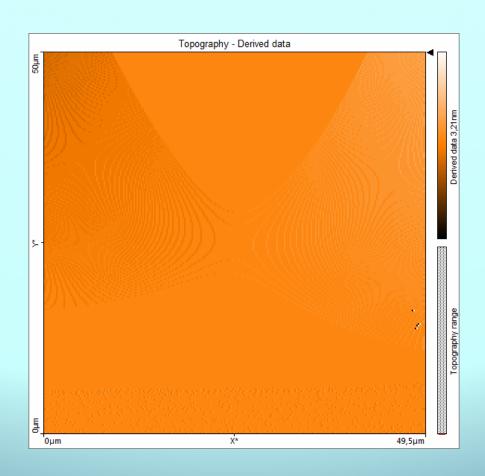
Kristallpartikel - mögliche Filmbildner, Filmeinbettung von 13 nm-Partikeln, Kristallisationen und Tröpfchenbildung

IV – Untersuchungsergebnisse

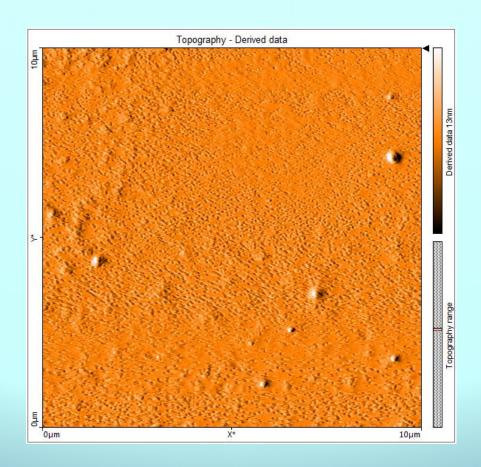
Polyester-Filamente nach Dekontamination Tensid-Rückstände in kristalliner Form



AFM-Scan – nach Ultra-Reinigung z.B Piranha etch und O2-Plasma

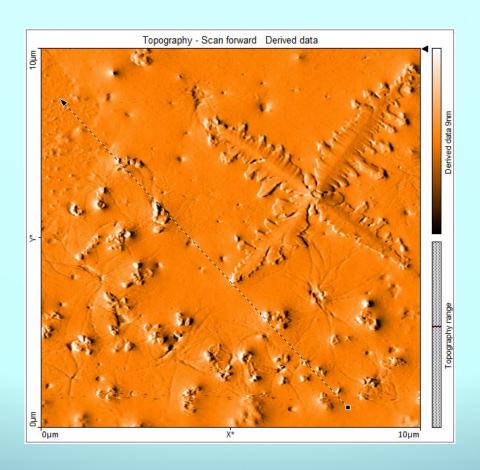


AFM-Scan - nach feuchtem Wischen mit Reinraumtuch



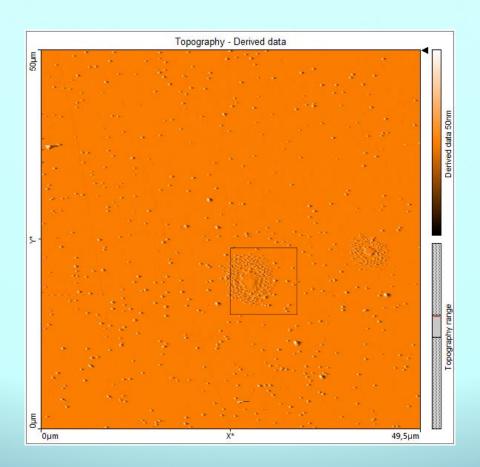
Die 13 nm-Gold-Sphären sind deutlich eingebettet in eine organische Schicht.

AFM-Scan - nach feuchtem Wischen mit Reinraumtuch und 30 min Wärmebehandlung



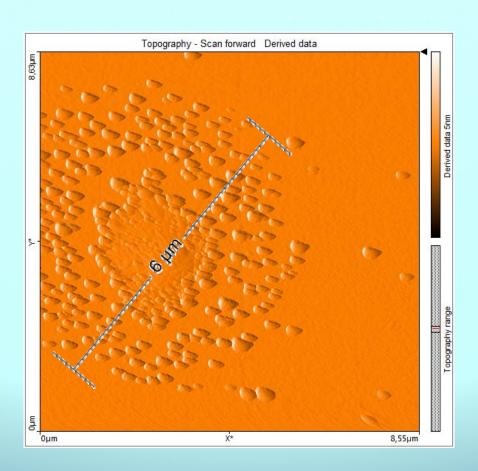
Die 13 nm Gold-Sphären sind eingebettet in eine organische Schicht mit deutlichen Kristallfiguren oben rechts.

AFM-Scan - feuchtes Wischen mit Reinraumtuch der Maschenzahl 1056



Tröpchenbildung auf der Oberfläche

AFM-Scan nach feuchtem Wischen mit Reinraumtuch der Maschenzahl 1056



Kristallisation von etwa 6 µm Durchmesser, Vergrößerung = 10.000-fach

I – Einführung

Tücherstruktur - Handhabung - Größenverhältnisse

II - Partikel

Instrumentarium, Vier Reinigungsbeispiele, Visualisierung mit AFM-Mikroskop Oligomere aus Polyestermatrix

III - Filme

chemische Rückstände auf Indikatorplatte, Massezunahme durch Wischvorgang, Schichtabtrag durch trockenes Wischen, Verunreinigungsrest nach Wischen

IV - Partikel + Filme

Kristallpartikel - mögliche Filmbildner, Filmeinbettung von 13 nm-Partikeln, Kristallisationen und Tröpfchenbildung

IV – Untersuchungsergebnisse

Untersuchungs-Ergebnisse

- 50 nm Partikel durch Reinraumtücher effizient entfernbar.
- 10 nm Partikel durch Reinraumtücher nur begrenzt entfernbar.
- Zunehmende Oberflächenrauigkeit ergibt abnehmender Reinigungseffizienz.
- Oligomere = Aus der Polyestermatrix ausgelöste Nanopartikel.
- Ölschichten bis zu etwa 5 nm Dicke durch Reinraumtücher entfernbar.
- feuchte Tücher haben im Nanobereich ein hohes Verunreinigungs-Potenzial.
- Feuchtreinigung führt evtl. zu Mikro Kristallisationen auf der Oberfläche.
- Die Abreinigung von Nanopartikeln und Schichten erfordert spezielle Tücher.

Instrumentarium und Hilfsmittel

- Atomkraft-Mikroskop Naio-AFM
- Gold-Sphären 13 und 50 nm, Quantum dots
- Dr.-Riss-Ellipsometer
- Nano-Partikel-Zähler
- Picogramm-Quarzwaage

Nanosurf GmbH - Langen
CAN GmbH - Hamburg
Dr. Riss Ellipsometerbau GmbH - Ratzeburg
Cordouan Technologies, Pessac, France
(Schäfer-Technologie GmbH - Langen)
Stanford Research Systems Inc., USA

Dank

- Wir danken den jeweiligen Beratungs-Ingenieuren der o.g. Hersteller für ihre Beratung: Herrn Dr. Marcus Weth (Nanosurf), Frau Katja Werner (CAN), Herrn Dr. Udo Riss (DRE), Herrn Dr. Lars Jansen (Schäfer) und Mr. Dave Ames (Stanford)
- Für die Beratung im Bereich der Laboranalytik und der Oligomerenbildung danken wir Herrn Dr. Dierck Knittel. Für die grafische Gestaltung Dank an Frau Cora Ipsen, für die REM-Bilder an Frau Yuko Labuda.
- Unser größter Dank gilt jedoch Herrn Martin Gerstmann vom Clear & Clean Forschungslabor. Ohne seine engagierte Laborarbeit würde die vorliegende Arbeit nicht in dieser detaillierten Form vorliegen.